

ABBジャパン、セミコン・ジャパンに初出展 半導体湿式プロセス専用の分析システム「WPA」を展示

(ABBジャパングループ発表) ABB株式会社(鈴木勇社長、東京都渋谷区)は12月7日(水)～9日(金)まで、幕張メッセ(日本コンベンションセンター)で開催される「セミコン・ジャパン2005」に初めて出展します。海外で豊富な実績を持つリアルタイムオンラインモニター用分析システム「Analyze^{IT} Wet Process Analyzer (WPA)」を、展示いたします。会場で引き合いをいただいたお客さまには、実際のプロセスラインでご試用いただく「お試しキャンペーン」も実施しております。

電力技術とオートメーション技術の世界的なリーディングカンパニーであるABBは、計装・計測機器の分野でも世界的なトップ企業です。ABBは、Hartmann & Braun、Bomem、Kent、Taylor、Elsag-Bailey、Fischer & Porterといった伝統ある計装・計測機器ブランドのテクノロジーを引き継いでおり、各産業・公益事業の広範なアプリケーション向けに、豊富な計測ソリューションをラインナップしています。

ABBの日本法人であるABB株式会社は現在、ABBのソリューション群の中から、日本のお客さまに最適な製品を選びすぐって順次ご紹介しており、半導体はもとより、石油化学、化学、医薬、自動車、鉄鋼といった業種で新規の導入をいただいております。

「セミコン・ジャパン2005」でご紹介するWPAは、半導体製造に特化した特許取得済の検知セル「Clipp^{IR}」を光ファイバー接続したフーリエ変換赤外線(FTIR)分光計システムで、最大8計測ポイントを、コンタミネーションが発生しない非接触状態でオンラインモニターできます。測定可能な成分は湿式プロセスで使用されるNH₄OH、H₂O₂、HCl、HF、KOH、NH₄F、H₂SO₄、NH₄F、HF、Acetic Acidなど30種類以上。販売価格は標準的なシステムで600万円からです。

リアルタイムな薬液モニタリングによって、最終製品の品質と歩留まりを向上させるだけでなく、最適な薬液管理によって薬液の使用量と廃棄量を低減し、コストの大幅な削減に貢献します。

ABBの半導体産業用分析機器は、表面処理装置の世界的な大手であるSEZ社でも標準的に使用されるなど、海外で豊富な実績を持っています。

ABBのブース(1A-011)にて、皆さまのご来場をお待ち申し上げます。

ABB(www.abb.com)は世界100カ国以上に103,000人のネットワークを擁する電力技術とオートメーション技術のリーディングカンパニーです。環境負荷を最低限に抑えながら業務効率を最適化するソリューションの数々を、産業界と公益事業のお客さまに提供しています。

本件に関するお問い合わせ先:

ABB株式会社 広報部 外川美穂(とかわ みほ)
Tel: 03-5784-6254 Fax: 03-5784-6281 bs.communications@jp.abb.com
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー
www.abb.co.jp

